# 眼见为实(上):磁畴成像

刘俊明

(南京大学物理学院 固体微结构物理国家重点实验室 南京 210093)

2020-03-04收到 † email:liujm@nju.edu.cn DOI:10.7693/wl20200417

看到了,才相信 安得物理论虚实,眼见为真定认知。 只是江山多乱序,此峰难断彼峰斯。

## 1 引子

自然科学,之所以在人类认识 和实践中具有崇高信誉和地位,笔 者以为有两个运行要素是重要的: 严密的分析推演逻辑和眼见为实的 理念。前者太过高深,笔者不敢谬 论;后者即为本篇学习体会之主角。 眼见为实,即"Seeing is believing", 通俗一些即"看到了,才相信"。刚 开始我们也许只能看到局部,如瞎 子摸象,然后我们相信局部并推演 全局,所以才有嘲笑瞎子摸象的勇 气。慢慢地,看到全部,凭智慧和 经验,我们就更为笃信。所以,科 学的内涵有一个重要方面即是: 谁 有办法让我们看到,谁就是我们的 眼睛和灵魂窗户,谁就是好科学!

看,或者观测,乃西方自然科 学从亚里士多德开始就奉行的经验 科学之核心。我们不妨总结为:"科 学乃从观测中来、到观测中去"。亚 历山大·弗莱明之所以偶然发现了盘 尼西林,是因为他在即将扔掉的培 养皿中观察到霉菌引起金黄色葡萄 球菌减少。而阿尔伯特·班杜拉的心 理学实验,则揭示出幼儿可以借助 观察他人的行为而学习之。这些小 例子,不过是科学史上无数个 seeing is believing 佐证之毫毛<sup>[1]</sup>。而这 一理念,推广到更广泛的"从实践 中来、到实践中去"的哲学思维, 也是广义的 seeing is believing。

当然,自然科学中,物理学家 最相信视觉或观测感受,其次才是 基于实验的推理,再次才是理论预 言。对眼见为实的追求,主导了实 验科学的发展脉络,这么说大概不 会有读者反对。反过来,物理学家 追求"眼见为实",很多时候都到了 痴迷癫狂的地步,也不知道是好事 还是坏事。

本文将从眼见为实的万花筒 中,挑几幅比较简陋的图画,来评 头论足一番,进而导出这些图画事 业的未来挑战。

#### 2 磁畴成像之理

众所周知,在凝聚态物理和功 能材料中,磁学与磁性材料不但历 史久远,而且已经大规模地介入我 们的日常生活。这一学科的发展和 大规模应用,除了好的材料外,很 大程度上有赖于对磁畴及其动力学 的操控。这种操控,首先是要"看 见"畴,然后要理解为何会形成磁 畴。所以,磁畴形成及其观测,就 成为磁学学科的一个重要方面。

#### 2.1 磁畴的形成

铁性材料中, 畴的存在早就是 天经地义的事情, 但却一直是研究 工作的关注点, 近百年来未曾中 断。我们现在的理解是:一个空间 尺度有限的铁磁体,其剩余磁矩在 电磁学上用磁感应强度B、磁场强 度H和磁矩M的概念来描述,它们 的相互关系如图1(a)所示。磁体一 端如果有磁力线发出体外,然后从 体外回到另一端而终止,此乃工程 磁学语言中形象生动的杂散场(stray field),如图1(b)所示,为空间有限 体系的伴随产物,虽然这么说并不 严格。这些杂散场携带了能量,其 信步所至,均带去能量、施加影响。

此类空间有限是一类磁体沿某 一方向上的约束。磁畴的形成,可 以简单地理解为降低布满外部空间 的杂散场所携带的磁偶极能(magnetic dipolar energy), 即退磁能。图 1(c-i)所示为一单畴磁体,其杂散场 分布区域广大。而削弱这一区域, 磁体内部会自发地发生磁矩重新分 布,形成磁畴。最直观的重新分布 即如图1(c-ii)所示形成上下两个畴, 杂散场得以大幅削弱。如果进一步 形成上下四个畴,如图1(c-iii)所示, 则杂散场会进一步削弱。不过,这 一进程也会反过来增加静磁交换能 (exchange energy),可以大致理解为 畴壁能。磁畴的最终形态与尺度是 磁偶极能与交换能相互竞争的产 物,如此而已。

当然,如果铁磁样品的尺寸和 外观形状发生变化,磁畴的形态会



图1 磁畴的形成机制 (a)磁体中磁感应强度B、磁场H和磁矩M的关系<sup>[2]</sup>; (b)磁体 单元 (畴)的杂散场 $H_{\circ}$ (磁体外磁力线)分布,磁体内部虚箭头 $H_{\circ}$ 为退磁场,实箭头为磁 感应强度 $B^{(3)}$ ; (c)为了降低杂散场导致的磁偶极能,形成的磁畴尺寸越小越好,而磁 交换能要求磁畴越大越好,两者竞争,导致一定尺寸和形态的各类磁畴形成<sup>(4)</sup>



**图 2** 磁畴观测模式的大致分类 (a) 表面观测与体内观测<sup>[5]</sup>; (b) 平行成像模式原理<sup>[6]</sup>; (c) 扫描成像模式原理<sup>[7]</sup>

有丰富的表现,如形成图1(c-v)之 类的畴结构。很显然,上部所示的 头对头(head-to-head)畴结构稳定性 差,而下部所示的头一尾相接涡旋 畴则基本能将杂散场全部消除掉, 此等畴必趋于稳定。不过,磁畴过 于细密,会导致畴壁能明显升高。 最终的磁畴结构到底取何形态,将 由一系列非常复杂的能量竞争来决 定。确定这些形态,成为工程磁学 的重要内容。 我们为什么要费尽心机去研究 这些畴?回答这个问题简单而艰 难。简单是因为,几乎所有工程磁 学应用都以畴为基本单元,而不是 以一个电子自旋为单元。因此,磁 学中讨论磁矩都是基于畴而展开 的。事实上,对所有铁性应用,均 是如此。艰难是因为我们肉眼通常 看不到磁畴,因为磁畴通常对应于 金属或半导体,对可见光不透明。 故而,对畴的使用,我们就不得不 面临瞎子摸象的窘境。

当然,当应用单元在未来某个 时候减小到一个电子自旋时,畴的 价值才会消退,但畴的新内涵也会 出来,从而生生不息。

这些复杂畴结构不能只是说说, 要有办法确认它们是不是如此。所 以,才需要有"眼睛"去看。不过, 仅仅就从简单介绍而言,要看清楚 磁畴,得考虑如下几点:

(1)畴的衬度:成像衬度高、成 像时间短、不能明显干扰畴原来的 状态;

(2)磁矩大小与方向:磁畴的矢 量成像技术。这类技术在诸如涡旋 畴和斯格明子等新的磁结构成像上 变得愈加重要;

(3)畴形态:表面畴结构和内部 畴结构的探测与区分。通过观测的 表面畴形态,来推测样品内部的畴 结构,这种方法已经被证明不可 靠。由于复杂的各种作用能纠缠在 一起,铁性畴通常存在显著的样品 空间不均匀性;

(4)空间分辨率:一种观测方法 不可能覆盖全部尺度,要看到不同 空间尺度的畴,要探测不同动力学 过程,就需要使用不同的观测技术;

(5)畴壁:除了畴本身的形态和 物理外,最近的发展趋势开始追求 畴壁结构及其动力学的成像,因为 自旋电子学等已经开始垂涎畴壁的 各种异数。

由此可见,我们看磁畴的畴眼 (domain eyes),不但要能够统观大 小畴及其模样,还要记录畴运动的 快慢、熟悉畴的各种古怪秉性。要 做到如此,客观而言,殊为不易, 挑战巨大!

#### 2.2 磁畴观测原理

探测磁性有悠久历史,从最初 的磁粉示踪,到现在基于同步辐射 和中子衍射的各种新技术,不一而 足。但对磁畴的观测,却未必乐 观,虽然一般还只是讨论铁磁畴。 从最简单的角度去理解这些观测原 理,无非是利用各种外界激励(磁、 电、光、热场等)与磁感应强度B发 生相互作用,反过来探测B的大小 和时空分布,由此绘制出磁畴的时 空形态。注意:这里的外部激励不 可显著改变B的原始状态,虽然微 小改变不可避免。

磁畴的各种观测技术纷繁复 杂,依据不同的立足点,可以进行 不同分类。

首先,表面观测还是体内观 测,对应就有基于反射和透射的观 测模式,如图2(a)所示。表面观测 技术着重于样品表面的信号探测, 在深度方向激励信号应快速衰减, 从而得到只属于表层畴结构的横向 分辨成像(laterally resolved imaging)。 表述这一性质的物理量乃衰减深度 λ。合理的表面磁畴观测技术要求 λ 应在几个纳米尺度内。与此相反, 体内观测技术,则着重提取深度方向的磁信息,然后进行平均。此时,透射探测模式不可避免。透射观测当然可以将样品整体磁性质展示出来,但其不足在于需要排除支撑衬底或去除样品中非磁材料部分。在磁性薄膜和异质结变得越来越重要的今天,这一缺点正在成为制约因素。

其次,关注样品成像模式,对 应于平行(同时)成像(parallel imaging)和扫描逐点成像(scan imaging) 模式,如图2(b)和(c)所示。同时成 像,如光学成像,其效率高、速度 快,但对成像本身有很高技术要 求,其分辨率可能也受到限制,典 型的有光学成像技术。扫描成像, 如扫描探针技术,则可以逐点扫 描,特别是对我们感兴趣的区域进 行重点关注,虽然这种扫描必然是 以牺牲效率为代价。

再次,其实是更重要的,即关 注成像模式所依赖的物理原理。参 考柏林自由大学物理学教授 Wolfgang Kuch 的文章 "Magnetic Imaging"<sup>[8]</sup>, 笔者再稍加补充, 可以形 成表1。

由表1看到,磁畴观测所依赖 的原理可以多种多样,技术细节更 是五花八门,需要根据具体观测要求 而选用。不过,一个很深刻的印象 是:直接利用磁效应本身,即磁偶极 间相互作用或者洛伦兹力作用来直 接显示磁畴,一则时空分辨率不 高,二则研制时空分辨的观测技术 举步维艰。历史上,这方面的努力 前后历经大半个世纪甚至更长,直 到磁扫描探针技术(MFM)的出现才 有所改善。

与此不同,材料科学发展至 今,通过重金投入,已经积累了很 多先进的材料微结构观测技术,如 XRD、电子显微术和若干特定的光 学显微术。其中,有相当一部分技 术,其观测的信号与样品电子结构 密切相关。材料的电子结构包括电 子自旋信息,这就给了磁性对电子 结构施加影响的机会。将这些机会

	,		
物理原理	适用于集成的测试技术	磁成像方法	备注
样品中B对磁颗粒施加力	光学显微镜/肉眼观测	磁粉成像	传统磁粉显示
样品中B对化学式的作用	光学显微镜/扫描电镜(SEM)	化学腐蚀	传统腐蚀、破坏性
样品中B对电子施加力 (洛伦兹力)	振动磁强计(VSM) 超导量子干涉仪(SQUID) 透射电子显微镜(TEM)	洛伦兹显微术(Lorentz microscopy)	分辨率 ~ 100 nm
外场施力于样品上	交变梯度磁力计 (alternating gradient magnetometer, AGM)	磁力显微术 (magnetic force microscopy, MFM)	分辨率 ~ 50 nm
磁矩进动	铁磁共振(ferromagnetic resonance,FMR)	尚无畴成像技术	
样品电子结构变化	磁光克尔效应(MOKE)	克尔显微术	光学分辨率
	X射线磁园二色谱(XMCD) 电子束(电子显微术)	XMCD + 光电子发射显微术(PEEM)	高分辨、同时元素分辨
		XMCD+透射X射线显微术(M-TXM)	高分辨
		带极化率分析的SEM (SEMPA)	分辨率~100 nm
		自旋极化低能电子显微术(SPLEEM)	分辨率~100 nm
		自旋极化扫描隧道显微术(sp-STM)	

表1 若干磁畴成像的原理、搭载技术与成像方法(各种方法的时空分辨率正在不断提高,这里的数据仅供参考)

一一叠加到那些与电子结构密切关 联的表征技术上,磁畴观测就做到 了借鸡生蛋,实现了弯道超车。这 就是X射线同步辐射和中子衍射等 一系列新的磁畴探测技术出现之 前提。

作为铺垫,本篇只简略介绍几 种经典磁畴观测技术,下篇将介绍 基于同步辐射技术发展起来的新技 术和更多的挑战。

## 3 传统磁畴成像

#### 3.1 克尔显微术

除了古老的磁粉显示技术和腐 蚀技术外,当前常用的磁畴测量技 术之一当属克尔(Kerr)显微术。克尔 显微术即通过测量横向分辨(laterally resolved)的磁光克尔信号(magneticoptical Kerr effect, MOKE)强弱来 成像,从而显示磁畴。这一技术乃 图 2(b)所示平行成像模式的典型。 当然,现在也有为了提升分辨率而 采用扫描模式成像的克尔显微镜, 变种很多。

众所周知,电介质物理中,介 电张量包含了与磁矩相关的分量。 因此,一束偏振光被磁介质反射 后,其偏振特性将带有磁矩的信 息。磁光克尔效应的基本物理图像 并不复杂:入射到样品中的电磁波 激发样品中电荷振动,如果对样品



**图3** 克尔显微术的原理 (a) MOKE的原理图; (b)克尔显微术观测畴的原理示意 图; (c)一台克尔显微镜的大概架构<sup>(9-11)</sup>



图4 两种典型铁磁性薄膜的磁畴图片,用克尔显微镜成像[12]

施加一定磁场**B**,此电荷运动会受 到磁场**B**施加的洛伦兹力,从而反过 来改变出射光的偏振状态。如果用 偏振片来操控偏振光强度,这一成 像技术的衬度基本上就是强度信息, 对光的频率和相位信息利用不多。

图 3(a)显示了 MOKE 的原理 图,图3(b)显示克尔显微术观测成 像的原理示意图,而图3(c)则是常 见的克尔显微镜的大概架构。很显 然,因为采用光学和静磁场的缘 故,这一技术在大气环境下使用非 常方便,分辨率也可达到微米级。 不过,如果要应用于相对极端条件 如低温和强磁场,或者要发挥光学 显微术的极限分辨率(极端靠近样品 表面,分辨率达到100 nm),则这一 技术会受到很大限制。图4是两幅 典型的铁磁畴克尔显微照片,毫无 疑问,图像很漂亮、出彩,但看起 来也就如此了。

#### 3.2 洛伦兹显微术

要获得高空间分辨率,克尔光 学显微术毕竟寸有所短。搭载于高 分辨电子显微术的磁探测无疑会 获得更高分辨率,洛伦兹显微术 (Lorentz Microscopy)即为其中代 表。这一成像技术也属于同步成像 一类。电子显微镜中的成像电子束 穿透磁性样品时,受到磁矩施加其 上的洛伦兹力。如果样品具有一定 尺度大小的畴,则这些畴的磁矩会 使得电子束路径发生微小偏转。捕 捉到这一微小偏转,即为成像衬度 奠定了基础。

图 5(a)所示即为 Fresnel 成像模 式的原理图。磁畴中的磁矩使得穿 过其中的电子束发生偏转,穿过相 邻两个畴的电子束相互干涉,则畴 壁处一定形成衬度。电子束会聚之 处的畴壁较亮,而电子束分离对应 的畴壁衬度较暗,观测结果如图5 (b)所示。如果要显示畴本身的衬 度,则可以通过添加光阑的方式实 现,如图5(c)所示。这是电子显微 术成像的标准操作。

除此之外,基于电子束穿过磁 性样品时受洛伦兹力作用发生偏转 这一原理,结合具体观测技术的不 同组合配置,可以实现不同的衬度 成像。其中一个代表性实例即近几 年用洛伦兹电镜对磁性涡旋畴、条 带畴和斯格明子的成像显示。图6 即为中国科学院物理研究所沈保根 老师课题组撰写的综述文章中所展 示的一组成果。

当然,洛伦兹显微术可以具有 很高的空间分辨率,揭示10 nm左右 的磁畴或磁结构应属易事。不过, 也有一些特定的磁畴结构,利用洛 伦兹显微术未必能成像磁畴。如图 7 所示的磁畴结构,用这一技术观 测可能就存在较大困难,详细描述 可见图说。与此同时,过去几十年, 透射电子显微术拓展出一系列新的 实时和高分辨动力学观测技术。洛 伦兹磁畴成像也走入一个快速发展 阶段,包括对磁畴翻转动力学的细 致观测。

#### 3.3 带极化分辨的扫描电镜

毫无疑问,洛伦兹电镜用于观 测磁畴已经很有优势,由于自旋电 子学发展更高的要求,国内外很多 科研机构都配备了这一仪器,使得 电镜生产厂商利润不菲。不过,相 比于TEM的操作复杂性和对样品制 备的严格要求,扫描电子显微术 (SEM)要方便很多。而且,大多数 情况下,磁畴的典型尺度用SEM的 分辨率已经足够。从这个意义上, 能够直接观测磁畴的SEM将会更加 受欢迎,更有广谱性。不过要注意 到,一般的电镜是不推荐用于磁性 材料观测的,因为残余磁性会降低 甚至损坏仪器的功能和精度。

1984年前后,Koike等人发展 了第一套能够分辨磁畴的SEM,称 之为Scanning Electron Microscopy with Polarization Analysis (SEMPA), 中文翻译成"自旋极化扫描电子显微 术",有时因为读音也戏称"桑巴"。 桑巴技术所依赖的原理很简单: SEM的入射电子束射入磁性样品表 层,激发出二次电子。这些二次电 子出射前因为与样品的磁矩相互作 用(也就是二次电子自旋被部分极 化),从而携带了磁矩的取向信息。

很容易推想,这种二次电子感 受到的相互作用不会很强,导致的 自旋极化信息将会非常微弱。因 此,需要有高度灵敏的自旋取向探 测器才能实现衬度提取, 而这本身 也是一个长期未能解决的挑战。当 前,最直接的方法,是利用自旋--轨道耦合较强的单晶材料,如Au和 W等重金属作为探测器,因为自旋 一轨道耦合强度随原子序数的四次 方成正比。这些探测器一定程度上 可以将自旋极化信号转化为微弱电 信号而提取出来。图 8(a)和(b)展示 了自旋极化探测的基本框架。可以 看到,二次电子自旋极化的分辨提 取部分显得非常复杂。考虑到自旋 极化和自旋一轨道相互作用都是二 级相互作用,都比较弱,最后得到 的畴衬度不会很强。事实上,图8(b) 所示衬度已经是最好的结果之一了, 可见桑巴这一技术的确存在不足。

当然,桑巴技术最大的优点有 二:(1)空间分辨率较高,在配置了



**图5** 洛伦兹电子显微术观测磁畴 (a) Fresnel 模式成像畴壁衬度的成像原理<sup>[13]</sup>; (b) 对应的观测结果: 畴壁的黑白衬度<sup>[13]</sup>; (c) 加装光阑和成像相差后的畴衬度与畴 壁衬度<sup>[14]</sup>



图6 (a)—(d) 50 mT磁场下磁畴与温度的依赖关系; (e)—(h) 场冷模式下,不同磁场处理导致的双斯格明子密度变化; (i)—(l) 与(e)—(h)相对应,是磁场上升到完全斯格明子态时,观测到的双斯格明子形貌。实验步骤显示于每一列的上方,实验样品为MnNiGa合金<sup>[14]</sup>



**图7** 洛伦兹显微术观测磁畴所面临的挑战 (a) 对于此类薄膜中头—头和尾—尾衔接的畴结构,因为杂散场在很局域空间内就自行闭合,如此,这些杂散场对穿越其间的电子束影响就很小,穿过样品的电子束被调控偏转的余地就极小,导致最终没有成像衬度<sup>(5)</sup>((i)和(ii)),(b) 对于这种面内闭合的涡旋畴结构,如果这种涡旋尺寸很小,洛伦兹电镜要显示出衬度也很难,图中所示衬度很淡,其实畴壁细节很难展示清楚<sup>(15)</sup>

场发射电子枪和更好的探测器后,磁 畴探测的空间分辨可以达到100 nm 左右,有足够吸引力;(2)表面畴结 构探测灵敏度高,这是基于SEM本 身的优点。事实上,对SEM技术本 身的那些优点,桑巴都可以继承下 来。但是,桑巴的缺点依然明显: (1)要获得衬度,需要大量二次电子 的自旋分辨成像,这就给空间分辨 率打了折扣;(2)样品需要在真空中 观测,且样品得导电。这一要求与 SEM形貌观测不同,所以成为一个 明显缺憾:对不导电的磁性材料, 这一技术就难以应用。

## 3.4 自旋极化低能电子显微术

其实,早在桑巴技术发明之前,物理学家已经将低能电子显微术(Low-Energy Electron Microscopy, LEEM)中的电子发射源用自旋极化的电子束来替代,发展了所谓的"自旋极化低能电子显微术(Spin-Polarized Low-Energy Electron Microscopy, SPLEEM)"。SPLEEM与桑巴的不 同是直接将入射电子束携带上自旋极化的信息,这将为LEED反射束 的自旋极化探测提供更好的衬度(图 9)。因此,这一技术似乎能一定程 度上弥补桑巴技术的不足。

为何如此说呢?这里有一个新的机制介入其中,使得LEED可以 超越桑巴。带有自旋极化的低能入 射电子束达到样品表面,与样品表 面磁矩相互作用,然后反射。反射 电子的状态与样品表面电子自旋极 化取向密切相关。其中,这些电子 的能量很可能正好是载流子少子或 多子在真空能级之上的能量差。由 此,反射的低能电子将更多地携带 样品自旋信息,形成更好的衬度。

事实上,LEEM和这里的SPL-EEM均是E.Bauer教授所开拓和发展起来的。LEED的发展历程有专 著加以描述,笔者不敢班门弄斧。 SPLEEM技术的关键之一是自旋极 化电子源和自旋操控装置,其中通 过复杂的静磁学设计和电操控来实 现。SPLEEM的特色之一是其在磁 畴成像的同时LEED的结构和形貌 成像功能依然保存,因此实现了磁 畴与表面微结构细节之间的一一对



**图8** 桑巴(SEMPA)探测磁畴的仪器原理(a)与提取的磁畴图像(b)。详细描述可见相关专业手册<sup>(16)</sup>



**图9** SPLEEM的基本构造与观测到的磁畴图像 (a)仪器大致的示意图,除了自旋极化的电子枪和自旋操控装置外,其他单元与LEED完全一样;(b)E. Bauer 教授课题组用 SPLEEM 研究单层 Fe 原子层畴演化的细节和铁磁相变之间的联系,可以看到磁畴 衬度特别好<sup>[5, 17, 18]</sup>

应成像,实属难能可贵。总之, SPLEEM是一款可以实现高分辨磁 畴成像的先进技术,对样品表面磁 畴细节也有很高分辨率。

但因为 LEEM 技术实用度与 TEM 和 SEM 相比不够宽广,这一 有效的磁畴探测技术用得相对较 少。而且,因为是使用低能电子, 电子束所携带的自旋信息对外磁场 就特别敏感,不像那些基于高能电 子的技术。而要观测的样品本身也 是磁性的,且观测外加磁场对样品 畴结构的影响及其演化也是物理研 究的重要一环。SPLEEM的这一缺 点就变成一个很大的问题,此处不 再加以描述。

#### 4 结语

就如"眼见为实"所要求的, 发展能够清晰显示磁畴结构的观测 技术非常重要。我们简单梳理了若 干经典磁性成像技术。事实上,这 些技术尚无一能够达成"看到全 域、看到全部、看到极端"的目标。 看到全域是要求成像覆盖的尺度要 宽,从纳米到宏观;看到全部是要 求对磁矩矢量成像,对样品深度成 像;看到极端则是说这些技术要能 够在极端高低温、强场、实时条件 下进行畴成像。

当然,自然之事,向来是得失 相左。任何技术获得一隅,多会失 却一陬。因此,磁畴成像技术的发 展还有长路漫漫。另一方面,本文 所列实例都是针对那些强铁磁的体 系。自旋电子学当前发展到一个新 的阶段,在追求更快更小之路上看 上了反铁磁这一大类被长期束之高 阁的材料。那么,问题来了:那些 反铁磁畴如何成像观测?这大概正 是很多物理学家当前囊中羞涩却君 子好逑的现状。我们将在下篇讲述 这一问题。

### 参考文献

- https://www.cebm.net/2013/12/seeing-isbelieving-or-is-it/
- [2] Ali S. Stray field and demagnetizing field. https://www.physicsforums.com/threads/strayfield-and-demagnetizing-field.936874/
- [3] Amaladass E P. Magnetism of amorphous and highly anisotropic multilayer systems on flat substrates and nanospheres. http:// dx.doi.org/10.13140/2.1.2794.0168
- [4] http://www.study-on-line.co.uk/whoami/ thesis/chap5.html
- [5] Kuch W. Magnetic Imaging. Lect. Notes Phys., 2006, 697:275
- [6] Parallel imaging is an approach for reducing scan time and includes techniques such as sensitivity encoding (SENSE)

and generalized autocalibrating partially parallel acquisition (GRAPPA). https:// radiologykey.com/parallel-imaging/

- [7] Gautam R, Samuel A, Sil S *et al.* Current Science, 2015, 108:341
- [8] Kuch W Magnetic Imaging. In: Beaurepaire E et al(eds). Magnetism: A Synchrotron Radiation Approach. Lecture Notes in Physics, vol 697. Springer, Berlin, Heidelberg.2006
- [9] Wang X, Lian J, Li P et al. J. Magn. Magn. Mater., 399, 2016:19
- [10] Soldatov I V, Schäfer R. Journal of Applied Physics, 2017, 122:153906
- [11] Idigoras O *et al.* Nanofabrication, 2014,1:3
- [12] http://oregonstate.edu/engr/magnetics/

magneto-optical-kerr-effect-microscope

- [13] Tanji T. Imaging Magnetic Structures Using TEM. In: Yao N, Wang Z L(eds), Handbook of Microscopy for Nanotechnology. Springer.Boston.MA. 2005
- [14] Peng L C, Zhang Y, Zuo S L et al. Chinese Physics B, 2018, 27(6):066802
- [15] Petford-Long A K, De Graef M. Lorentz Microscopy. In: Characterization of Materials. John Wiley & Sons, Inc. 2002
- [16] https://www.klaeui-lab.physik.uni-mainz. de/sem-with-polarization-analyzer-sempa/
- [17] https://web.asu.edu/ernst/spin-polarizedlow-energy-electron-microscopy-spleem
- [18] Zdyb R, Bauer E. Phys. Rev. Lett., 2008,100:155704-1-4.



## 大连齐维科技发展有限公司

地址:大连高新园区龙头工业园龙天路27号 电话: 0411-8628-6788 传真: 0411-8628-5677 E-mail: <u>info@chi-vac.com</u> HP: http://www.chi-vac.com

表面处理和薄膜生长产品: 氩离子枪、RHEED、磁控溅射靶、束源炉、电子轰击蒸发源、样品台。



超高真空腔室和薄膜生长设备: PLD系统、磁控溅射系统、分子束外延系统、热蒸发镀膜装置。

